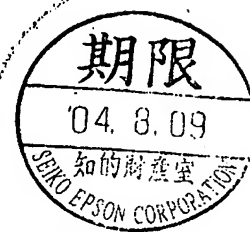


拒絶理由通知書



特許出願の番号 特願 2003-164159  
起案日 平成16年 6月 4日  
特許庁審査官 右田 昌士 9513 2X00  
特許出願人代理人 上柳 雅誉 (外 2名) 様  
適用条文 第29条第2項

J0002926  
US02 公開

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の記事に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1-5 引例1

請求項6-9 引例1-3

備考

請求項1-5について

絶縁膜の厚さについては、引例1の発明の詳細な説明第19段落を参照。

請求項6-9について

反射電極上に酸化シリコンからなるパッシベーション膜を設ける構造（周知：例えば引例2、3を参照）を引例1において採用し、請求項6-9に係る発明とすることは、当業者にとって容易である。

引用文献等一覧

引例1：特開平7-84285号公報 引例手配済×

引例2：特開平8-179377号公報 引例手配済

引例3：特開平6-148679号公報 引例手配済×

なお、この拒絶理由に不明な点がある場合、又は、この案件について面接を希

・調査した分野

IPC第7版	G02F1／13.43
	G02F1／13.62
	G02F1／13.33
	G02F1／13.35
	G02F1／13.45

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。